

レーザー学会産業賞「奨励賞」受賞



フォトマスク欠陥検査装置 (MATRICS X700 シリーズ)

レーザーテック株式会社



APPLICATIONS

- ウェハファブにおけるフォトマスクの受入検査および定期検査/ヘイズ検査
- マスクショップにおける出荷前検査（ペリクル貼り付け後も検査可能）

KEY FEATURES

- hp45nmノード以降の最先端フォトマスクの欠陥検査・品質管理に最適な装置
- 位相シフトマスク（EPSM, APSM）及び OPC（Optical Proximity Correction = 光近接効果補正）マスクに対応
- 光源に自社開発の213nm全固体レーザーを搭載し、高感度欠陥検出を達成
- OHT自動搬送との接続等フレキシブルなインターフェースが可能（オプション）

MAIN SPECIFICATIONS

- 検査方式：マルチダイモード（アレイモード含む）、シングルダイモード及びそれらの複合検査
- 検査光：透過光、反射光、透過/反射同時照明光
- 検出感度：最高感度25nm
*検出感度は、欠陥タイプ・検査方式により異なります。
- 検査時間：
105分/100mm²（ノーマルスキャン）
60分/100mm²（ファーストスキャン）